《现代微加工技术》前两周自学内容要求

通过网上查询和参考资料来了解学习相关内容，摘录小结后可选择发至如下邮箱chcao@nju.edu.cn。

1. 超净间安全卫生规章，常用化学试剂和工艺气体安全使用规章。
2. 清洗技术，工艺原理上分物理清洗和化学清洗，形式上分湿法清洗和干法清洗。了解学习工艺原理，通过硅片的常规清洗方法，参考文献报道，拟定你实验中使用基片的清洗步骤。
3. 光刻技术，了解学习光刻工艺的工艺原理，分清正性光刻胶和负性光刻胶的特性，了解涂胶、前烘、曝光、显影和后烘的工艺原理和要求，学习常规接触式紫外曝光光刻技术，电子束曝光光刻技术，激光束扫描曝光技术。
4. 通过文献查询，简介你研究的器件样品制备流程和技术要求，供大家交流学习借鉴。

电子科学与工程学院 曹春海

2020-02-14